JP A 0114931 SEP 1981

(54) LIQUID-CRYSTAL DISPLAY BODY

(11) 56-114931 (A) (43) 9 9 1981 (19) JP

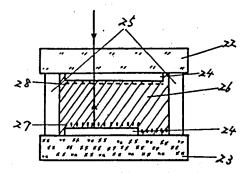
(21) Appl. No. 55-17273 (22) 15.2.1980

(71) SUWA SEIKOSHA K.K. (72) NORIHISA OKAMOTO(1)

(51) Int. Cl3. G02F1/137,G02F1/133,G09F9/00

PURPOSE: To obtain a reflex type display body which provides clear-contour display without shadow, by orienting the liquid crystal of a phase transition type guest-host liquid crystal display body vertically on one opaque substrate surface and horizontally on the other transparent substrate surface.

CONSTITUTION: As for the phase transition type guest-host display body in which bicolor coloring matter is added to liquid crystal with positive dielectric anisotropy showing the cholesteric phase, transparent electrode 24 is provided on one lower opaque light-reflective substrate 23 and vertical orientation treatment 27 of a chromium complex body, etc., is carried out. On upper transparent substrate 22, transparent electrode 24 is provided and after polyimide is applied, a horizontal orientation treatment is done by lapping. Consequently, when the display body is applied with an electric field between electrodes 24, an excellent-contrast picture having neither color unevenness nor shadow can be obtained. As opaque substrate 23, a light scattering metallic electrode having an uneven surface may be used.



(9) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56-114931

庁内整理番号 7448-2H 7348-2H 7129-5C 砂公開 昭和56年(1981)9月9日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

❷液晶表示体

②特 願 昭55-17273

G 09 F 9/00

②出 願 昭55(1980) 2月15日

@発 明 者 岡本則久

諏訪市大和3丁目3番5号株式 会社諏訪精工舎内 ⑫発 明 者 村田雅巳

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑪出 願 人 株式会社諏訪精工舎

東京都中央区銀座4丁目3番4

号

仍代 理 人 弁理士 最上務

明 継 4

発明の名称

液晶表示体

特許請求の範囲

(1) 表示セルを解成する一方の基板として不透明 蓄板を使用した液晶表示体に於て、液晶としてコ レステリック相を示す時電異方性が正の液晶に二 色性色素を添加した液晶を用い、さらに該液晶分 子は、不透明蓄板側では蓄板表面に無面に配向し、 対向する透明蓄板側では蓄板表面に水平に、配向 させた事を特徴とする液晶表示体。

(2) 不透明蓄板として、不透明絶談体上に、透明 電極を設けた事を特数とする特許請求の範囲第1 項記載の液晶表示体。

(3) 不透明基 敬として、 表面が凹凸形状を呈する 光 飲乱性金属電像を用いた事を特徴とする特許請求の範囲第 1 項配載の数 最 表示体。

発明の辞典な説明

本発明はコレステリック相を示す財富異方性が 正の数点に、分子の配向方向により発色の異なる 二色性色素を添加した液晶組成物を対向する電極 間にはさみ、電界の印加除去に伴えう色素の発色 の変化を用いて表示を行なう相転移型ゲストーホ スト表示体に関する。さらに詳しくは、表示セル を構成する一方の基板として、不透明蓄板を使用 し、影の無い輪郭の明瞭な表示を行なう反射型表示体に関する。

コレステリンク相を示す跡覧具方性が正の被品に、二色性色素を添加した組成物を用い、電界の印加除去に伴なうコレステリックーネマチック相転移に基づく発色変化を利用して表示を行なう。相転移型ゲストーホスト表示体は、下配の長所を有し、注目されている。

- 1. 催光板無しで高いコントラストが得られる。
- 2. 視角依存性がない。
- 3. 表示全体が明るい。
- 4. 応答が速い。

第1 図に、相転移設 グストーホスト 効果の 数示息 理を示す。 第1 - a 図は 電界無印加時の 版 品分子 1 及び色素分子 2 の配向 状態図 を示し透明 電極 3 、 自然光 4 、反射板 5 、カラス 器板 6 、スペーサ 7 、

-2-

から構成されている。 液晶分子は質値表面 3 に垂直方向に進むに従い、 脳次 その配向方向を旋回するグランジャン組織をとり、 このため色素分子は任意の方向に偏った光 3 を強く吸収し、 強く発色する。一方 1 1 1 1 1 2 5 の色を呈する。 人射光 10 を完全に透過し、反射板 5 の色を呈する。

この様な相転移型ゲストーホスト効果は、 観界 印加により、 殆色状態から透明状態への変化しか できず、 従って表示としては、 カラーの背景に自 抜き 表示となり、 ドット型 マトリックスや、 ウォ ッチの 1 デジットーセブンセグメント 表示等小さ な 画気には、 光の入射角 既により 半彫ができ、 奥 効的コントラストが低く、 不向きとされていた。

第2図は従来のホワイト・テーラー型ゲスト・ホスト効果を用いた液晶表示装置の断面構造の図であり、2枚の透明素板12、較透明素板の液晶層側に形成され気流角質を13、反射板14、液晶15、

-3-

は電圧が印加されていない部分、即ち、色素が吸収を起こしている部分であり、中央の抜けた部分が電圧が印加された部分、即ち、色素が形収をしない部分である。18 は反射面であり斜めに入射する光21により照射される部分が19 a . 19 b の部分である。20 b の部分である。20 c のような投示を透面蒸板の面に垂直な方向から見ると第3 ー a 図の場合には20 a の部分はほとんど見えずに、明るい19 b の部分がほとんどである。以上の限明から距離 / はなるべく短い方が表示の品質が向上することがわかる。

つまり、コントラストの低下を防ぐ手段としては、下側監板又は下側監板上の低低化値接反射板の機能を持たせ、散晶層を直接又はほとんど直接に、反射面に扱する方法が良いと考えられる。ところが、表示として望ましい白色反射板を用いることがには、かなり数面の凹凸を大きくし、光散気面をつくらればならず、従来の表面処理ではこの様な荒れた数面での配向を制御しえなかった。特

シール16から構成されている。透明基板12は一般 的にはガラス基板が使われている。 透明電極 13と しては酸化インジウム IngOg , 酸化スズ SnO, が使 われている。反射板14は透明プラスチック基板の 透明基板と接しない面に小さい凹凸を設け、アル ミ等の反射物質の階段を蒸濫したものが用いられ ている。従って上側の透明基板の面に垂直に入射 した光は数晶層で変調され下側の透明蓄板を通過 し、反射板14の中を通り反射板14の反射面により 反射され、再び、入射したときと逆の肌で出てい く。とのような構造では光の変調される液晶層と 反射面の距離とが表示電磁の大きさに対して比較 的大きくなる。このため毎日を印加して光が透過・ する部分の照度が比較的低くなり表示のコントラ ストをさげる結果となっていた。第3一4,6凶 は透明遊板の面に対して45°で入射する光により 投光される反射面の様子の液晶層と反射面との距 雌ルによる違いを示したものであるが、 訊3−a 図は距離とが大きい場合、単3一も図は距離とが 小さい場合である。17が散晶層であり、黒い部分

にラピング等での平行処理はそれに基づく欠陥の 発生が多く、又斜め蒸煮でも影の部分はほとんど 配向しないために、色ムラ、見かけのコントラス トの低下等をもたらしているのが実情である。

本発明の特徴は、この様な配向の問題点を解決すべく、白色化のために凹凸荒らした表面は垂直処理を施し、対向する素板表面は水平配向させたセルに、比較的ピッチの長いコレステリック新品と二色性色素からなる組成物を用いて、真白な基板上に、影や色ムラの全くない二次元極像を形成した点にある。

以下、実施例に従い本発明を説明する。
(実施例1)

第4図は本発明に基づく表示体の構造であり、 上側基板22、下側蓋板23、透明電板24、シール25、 液晶限26、垂直配向処理27、水平配向処理28で構 成されている。上側基板22は透明なガラス又はブ ラスチックであり、下側基板23は不透明な光反射 性の基板である。下側基板の例としては、セラミ ックス、着色ガラスなどがあげられる。透明電極 ・24 は酸化スズ又は酸化インジウムである。液晶層 26 に封入される液晶としては前記のように相転移 型グストホスト液晶組成物が用いられるが、表1 にホスト放晶を、 又表 2 に二色性色素を示す。. ホスト被晶としては、全体として勝電異方性が正 のネマチックが晶組成物に光学活性物質、コレス テリック液晶等を適当整能加したものが比較的ビ ッチも長く、転移缸圧が低いために実用的である。 二色性色素は一般に被晶中での配向性の関係から 裂2の如く権状のものが多く。 本実施例に於いて は、水1を0.8重量が用いてある。下側器板はク ロム錯体、ジメチルシラン等の垂直処理27が施さ れ、上側カラス番板はポリイミド塗布後ラビング の水平配向処理28が施され、その間を設晶分子は 番 板 表面 か ら 垂 直 方向 に 進 む に つ れ デ イ レ ク メ ー の方向が順次旋回するグランジャン組織をとって いる。上下電極間に電界を印加する事により、出

災 施 例 1 は 下 側 器 板 目 体 が 不 透 明 絶 縁 体 で あ る

1-6 図と同様ホメオトロピック配向となり反射

-7-

.が蓄板自体は透明なものを用い、液晶層側に反射 膜を生成したものも考えられる。

以下に実施例2として詳しく説明する。

(夹施例2)

板の色が見える。

節 5 図は実施例2 の液晶投示体の断面図であり 上轉基板29、下側基板30、透明電板31、液晶隔32、 シール33、反射與34、絶縁膜35から構成されてい る。即ち、ガラス谷の下側透明監板30の表面に私 , Au , Ag , Crたどの金属の反射膜34を生成し、 これを 7000Å ~ 8000Å 程度の Bio: , Tio: , A&:0: などの絶縁與35で被服し、その上に通常の透明電 極を形成してある。金属反射製34は、下質器板全 面に形成すると、液晶に駆動な圧を加えた場合に 34の電位が下側基板上の透明電極31に近くなり。 ・34と上側基板の透明電極が直接対向した部分の額 最がON状態となってしまう。そこで、囟のどと く、一定、蒸浴等で良を均一に生成した袋、フォ トエッチング工程で細い島状化パメーニングして、 各々の鳥が質気的に独立にして、このような不動 合を防ぐ。長の大きさは大体。数10~100Am 程度

秀 1

組	成	物	直對多
n-C,H,-®-C	10.4		
n-C + H + -			20.7
я-С ₅ Н ₁₁ -	-0.СН	•	11.2
n-C ₃ H ₇	-CN		9.0
n-C 4 Hg	-CN		15.5
n-C 5 H 11	-CH		12.1
C ₂ H ₆ -⊕-COO-⊕-CN			13.8
и-с в Н 11 - Ф-Ф-Ф-СИ			5.3
(+)C 2 H 6 - CH (CH 2) CH 2 - (5)- CN			2.0

表 2

	7 造	蚁 权植大波县
1	n-C, H, O, S N=N-O-N=N-O-NC, H, C, H	600 nm
2	G-N-N-O-N-N-O-NC2H2	490 nm
3	ОИН-6-0-п-с, н, 600 0 0 н	590 nm
4	onh-o-c.h. 6Co c.ho-hvo	550 nm

-8-

で、島と島の間のギャップは反射線の反射効率を ・ 下げないためには、なるべく狭いことが必要であるが10~20m飛程度が適当である。

実施例2は反射数として海体を用いているためフォトエッチング工程及び 8:0. 形成工程が必要となるが、絶缺性の高い反射段が形成できれば、これらの工程が省略できることは勿論である。

以上の2 実施例は、下側蓋板が反射層を兼ねる ものであるが、下側蓋板の電極が反射層を兼ねる ものも考えられる。以下に、実施例3 ・ 4 として 申しく収明する。

(吳施例3)

乗6図は実施例3の液晶表示体の断面図であり、 上側高板36、下側高板37、透明電極38、反射型電 低39、反射膜40、液晶脂41、シール42から構成さ れている。第2図の従来の液晶セルと比較して、 下側高板の電極が透明でなく反射層となっている こと、独立の反射板を設けず、下側高板37の液晶 と扱しない面に反射膜を設けた点が異なる。跨電 異方性が正の根駄移型のゲストホスト放晶では、

特開昭56-114931(4)

本ガタイプの表示が現在のところ容易である。即ち、電圧が印加された部分のみ色が抜ける。従って、電極39が反射展を魅ねているので、表示の抜けた部分に影は出来ずに、鮮明な設示が得られる。下側基板の反射電極30が存在しない部分に入射した光は、反射與40により反射される。ところが、本 実施例では反射電極が存在して電圧が印加されないセグメントの部分と反射電極が存在しない部分のコントラストが少し異なる可能性がある。そこで考えられたのが実施例4であり、以下に詳しく説明する。

〔與施例4〕

第7ーα 図は契約例4の液晶表示体の断面図であり、上側蓋板43、下側蓋板44、送明 単板45、反射監板46、反射監47、液晶階48、シール49で構成されている。実施例3の下側蓋板の製鋼の反射層40を設けるかわりに、液晶脂似に47を設けたことが特徴である。反射電板46と反射製47は同時にムル等の金銭をスパックリング又は蒸潰で形成し、フォトエッチングにより、10 4~20 4 m 程度の目

-11-

表 4

		西面水平	片面水平片面垂直	西西西西
*	Œ	3 Ⅴ以上	中間	ヤヤ低い
応	答	Off が迷い	比較的速い	Off が強い
コント	ラスト	ある	中間	ヤヤほい
91	観	透明均一	介面で少し形式	樹る

ガラス表板の如く、光学研磨状態で使用できるものについては、外級も透明で均一度の高い両面平行が超ましいが、荒れた表面の場合には、配向ムラがなく、電圧も低く(腕時計に用いる際には非常に大きいメリットとなる)応答も遠い、片面水平、他面垂直のハイブリッド配向が最適と言える。

第8凶に、本発明に基づく表示体の能能側に能 外を印加した際の電圧一反射率特性を示す。機能 は電圧、縦軸が相対反射率を示す。

コレステリック相のラセン構造に基づく強い発 色状態▲から出発し、電界の増加に伴いVikで反 射率が立ち上がり、白潤状態Bを経て、Vaで透明 に見えない程度のギャップを設けることにより作 成する。 毎7- b 凶はこのような工程後の下側番 似の図を示している。以上のごとく、パネル構造 の実施例は色々と考えられる。

次に垂直配向処理の方法について述べる。 これら白色化するために荒した製面をもつ基板に 於ける配向としては、例えば処理なへの侵責等が 容易な手段であり、垂直処理が通している。 扱 3 にこの様な垂直処理剤の主なものをあげる。

3

М	垂直処理剤
1	クロム系有機金属錯体
2	シラン糸カップリング剤
3	フッソ系界面活性剤
4	チタン系有限金属錯体

相転移型グストーホスト効果の場合、コレステリック液晶のねじり力が強いために、 装面処理の組み合わせとして性々のものが可能である。 表 4 に代表的なものとその特徴を示す。

-12-

カホメオトロピック状態 C に到る。逆に電界を下げる時、 Vaよりかなり低い所迄なだらかに減少し、途中に自濁状態 D を経て、 ゆっくりと初期状態 A に戻る。 20 ℃ 3 ♥ での応答スピードは O N で 80 m asc. O F F で 110 msec である。

以上の実施例からも明らかな如く、本発明に基づく液晶表示体は、完全二次元面像を動かすという点で、反射型表示の頂点に立つものであり、これによりクロック、カルキュレーター等の数字表示体はもちろん、パーソナルコンピューターの端末ディスプレイから、ドット表示型ウオッチ等にまでその用途が開けるものと確保する。

図面の簡単な説明

第1図は、相転移型グストーホスト表示体の表示原理を示す。第1-a図は電界無印加時、第1-b図は電界印加時を示す。

1 ・・液は 2 ・・二色性色素 3 ・・透明電極 4 ・・自然光 5 ・・反射板 6 ・・ガラス 基板 7 ・・スペーサー 8 ・・二色性色素

特開昭56-114931(5)

9 • • 液晶分子 10 • • 自然光

胡2凶は、従来の相転移型グストホストパネル の構造図である。

12 • • ガラス基板 13 • • 透明 監極 14 • • 反 射板 15・・液晶層 16・・シール

第3回は、液晶層と反射層の距離と違いによる **表示コントラストの違いの説明図である。**

17 · · 液晶層 18 · · 反射層 19 · · a , b 投 光部分 20··a.b不投光部分

第4図は、実施例1の表示体断面図である。

22 • 选明基板 23 • • 不透明基板 24 • • 透 明監極 25・・シール 26・・液晶階 27・・垂 直配向処理 28 • 水平配向処理

第5図は、実施例2の表示体断面図である。

29 • • 上側蓋板 30 • • 下側蓋板 31 • • 透明 **階極 32 · ・ 液晶暦 33 · ・ シール 34 · ・ 反射 屆 35 • • 絶談膜**

銀6図は、実施例3の表示体断面図である。

36 • • 上何基板 37 • • 下傳基板 38 • • 透明 39 • 反射電極 40 • 反射層 -15-

第7-a 図は実施例4の表示体断面図である。

41 • • 上側蓋板 42 • • 下側蓋板 43 • • 透明 **缸 極 44 • • 反射 監 極 45 • • 反射 層 46 • • 液** 晶層 47・・シール

第7-b 図は、 契施例 4 の下側 基板 42 の外 観図 である。

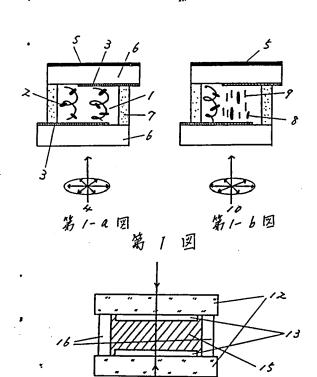
第8図は、本発明に基づく表示体の電圧一反射 率特性を示す。

上

出顧人 保式会社諏訪特工会

代理人 战

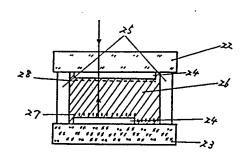




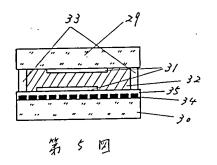


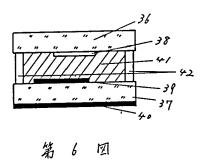
第3-Q国 第3图 第3-6图

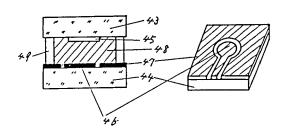
- 16-



第4四







第7-18

第7-6图

第7回

手 続 補 正 書 (自発)

昭和56 年 1 ^月30

特許庁長官 段

1. 事件の表示



昭和 55 年特許獻 第 17275

2. 疑期の名称

.

3 単正をする者

事件と関係 出版人 東京都中央区銀歷 4丁目 5番 4号 (256) 株式会社 歳 訪 精 工 合 代表取締役 中 村 佤 也

, # RE 1

〒150 東京都渋谷区神宮前2丁目6番8号

(4664) 弁理士 最 上



連絡先 563-2111 内線 223~6 担当 長谷川

5. 補正により増加する発明の数 0

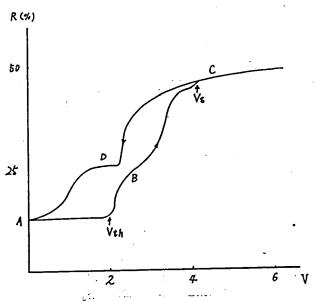
6. 袖正の対 #

朔 細 看

7. 補正の内容

明細書8頁数1を別紙の如く補正します。

第8回



組 成 物	重量 5
n-C ₃ H ₇ -(H)-COO-(J-O. C ₂ H ₅	104.
n-C ₄ H ₉ -(H)-COO-()-O. C ₂ H ₅	2 0.7
n-С ₅ H ₂ -Ф-соо-Ф-о. Сн ₃	1 1, 2
п-С ₃ Н ₇ -Ф-соо-О-си	9. 0
n — С4 Н9 — Ш — С О О — С И	1 5, 5
n — С ₅ Н ₁ (— Д) — С О О — С) — С И	1 2 1
С ₂ Н ₃ —(_)—ОСО—(_)—СИ	1 3.8
n – C ₅ H ₁₁ – Čj– Cj– Čj– C N	5, 3
(+)C2H5-CH (CH2)CH2-Q-Q-CN	2.0

以 上 以 化甲人并埋土 数 上 数 近